(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

¹⁰ 公開特許公報(A)

昭55—2416

⑤Int. Cl.³ A 61 B 5/04 G 01 N 27/30 27/56

識別記号

庁内整理番号 7309—4 C 7363—2 G 7363—2 G 母公開 昭和55年(1980)1月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全10頁)

匈生体用電極

②特

願 昭53--74530

29出

頭 昭53(1978)6月20日

⑩発 明 者 薄準一

武蔵野市吉祥寺北町四丁目七一

二三愛荘

⑪出 願 人 薄準一

武蔵野市吉祥寺北町四丁目七一

二三愛荘

⑪代 理 人 弁理士 伊藤貞

外2名

明細 1

発明の名称 生体用電極 特**許請求の**範囲

シリコン基体上に登化シリコン膜を被着して成る生体用電極。

発明の詳細な説明

本発明は、心電図、動電図、脳波測定等の生体情報を生体電気現象として観測する場合の生体に 取着される生体用電響に係わる。

ン伝導体であるため、両者の伝導機構が異なり、その界面での電荷の授受が化学反応を伴うためと考えられる。また、金属・電解液間には電極電位や分極電圧のような直流電位が生じており、これが、生体現象を電気信号として検出する検出回路の増幅器を飽和させ、これがため波形面を起とすという幣害も生する。

一方、生体用電極として、要求されることは、 検出回路の増幅器の入力インビーダンスに比べ、 電極自身のインビーダンスを低くすること、電極 と電解液界面で生じる雑音、及びドリフトを小さ くすること、機械的に強く、腐蝕しないこと、更 に、生体への装置が確実、容易であること、安価 であることなどである。

そして、上述した電気化学反応による電荷の投 受を少なくし、その不安定性から生じるドリフト 維音を少なくできる生体用電極として、金属と生 体の皮膚(電解液)との間に誘電体を介薄させ、 この誘電体による幹電容量を介して生体の交流信 号を検出する電極が提供された。このように、誘

-91-

特別昭55-2416(2)

電体を用いたものにおいては、 直流平衡 健位が入力に現われることによる前述した増編器 の飽和を回避でき、ドリフト雑音を小さくすることができ、更に、生体への装着に当つて導電ペーストを用いる必要もないので長時間モニターに好適である。また、その絶縁性によつて電撃防止効果があるなどの利点がある。

(3)

波成分の信号の検出が容易となり、その温度依存性も小さく、安定した特性を有し、ドリフト雑音の減少も十分満足できる生体用電極を提供するものである。

以下、本発明による生体用電極について詳細に 説明する。第1図は、本発明による生体用電極の 一例を示し、図中(1)は本発明による生体用電極を 全体として示す。

本発明においては、シリコン基体、例えば単結晶シリコン基体(2)の1 主面 (2a) を鏡面に仕上げ、この主面 (2a) に誘電体膜として、特に盤化シリコン Si₃N₄ 譲(3)を被着する。(4) は、生体を示し、この生体(4) に対し、電極(1) が、図示しないが接着テープ等によつて、その鍵化シリコン膜(3) が生体(4) に接触するように取着される。(5) は、基体(2) 倒より導出された端子で、例えばインビーダンス変換器(6)を介して検出回路に接続される。

窒化シリコン膜(3)は、モノシラン (SiH₄) - アンモニア (NH₃) 系の低温気相成長法、いわゆる C V D 法 (Chemical Vapor Deposition) によつ に際しては、その圧電効果による影響を考慮して 細心の注意を払って装着することが必要であると いう不安定性と手間の問題がある。

このような欠点を回避するものとしてシリコンウエフアを用い、その表面を熱酸化して酸化膜、即ち誘電体膜を形成するようにした生体用電極が投栄された。ところが、この構成による電極は、その特性が比較的不安定であるとか、ドリフト維音が十分低波化できないとかの欠点がある。

そして、他の生体用電額として、金製体上に、蒸着によつて酸化けい素膜より成る誘電体腱を被 着した電極が、本発明者によつて投案された。こ の電極は、安定した特性を示し、また、その誘電 体膜の特性、特に誘電率、厚さ、絶縁性の選択の 自由度が増し、ドリフト雑音も可成り改善される ものである。

本発明は、上述した酸化シリコンの蒸着膜による
影覧体膜を用いた生体用電極と同様に圧電効果
による不都合がなく、しかも、この酸化シリコン
の蒸滑膜に比し、2~3倍の誘電率を有し、低局

(4)

てシリコン基体(2)上に生成し得る。この C V D 法は、シリコン基体(2)に対する窒素の直接反応ではなく、低温での化学反応による膜形成法で、この化学式は、一般的に、

 $3SiH_4 + 4NH_3 \rightarrow Si_3N_4 + 12H_2 \cdots (1)$ と扱わせる。そして、この窒化シリコン膜(3)をシ リコン基体(2)上に気相成長させるための装置は、 第2図に示すような通常の気相成長装置を用い得 る。即ち、例えば、高周波誘導コイル(7)が配置さ れた石英炉心管(8)内に、キャリアガスとしての H₂ ガスと共に、モノシラン SiH₄ガス、及びアン モニア NH3 ガスを送り込む。(9)、(0及び(1)は、各 ガスの送給量を調節する弁である。炉心管(8)内に はシリコン基板(2)が配置される。シリコン基板(2) は、例えば厚さが 250 mm で、たて及び横が失々 約10mmのほぼ正方形をなし、板面が、!!! 結晶面 に沿うように切り出された比抵抗が 0.025Ω·cmの 単結晶シリコンウエフアを用い、これを十分洗剤 し、表面に酸化膜をエッチングして除去して用い る。そして、このシリコン基板(2)を炉心管(8)内に

特朗昭55-2416(3)

配置した状態で炉心管(8)内を H_2 界囲気に置換し、その後高周放誘導加熱を開始し、シリコン基板(2)が例えば 950℃になるまで昇温し、この温度に約10 分間保持して後、モノシラン SiH_4 ガスと、アンモニア NH_3 ガスとの混合比が、例えば 1:200 となるように、例えば SiH_4 ガスを 5 cc/分の流量で、 NH_3 ガスを 18/分の流量で、 H_2 ガスを 3.58/分で送り込む。このようにすると前記(1)式の反応によつてシリコン Si_3N_4 膜が析出生成される。

このようにして析出生成される窒化シリコン膜の膜質及び膜厚は、各ガスの混合比、流量、反応処理温度等によつて選定できる。第3回は、上述したCVD条件にかいて、反応処理時間と、生成される窒化シリコン膜の膜厚の関係を測定した結果を示すもので、反応時間5分間で約1000Å、15分間で3000Åとなる。

上述の本発明による電極(I)において、その監化 シリコン譲(3)の厚さは、これにピンホールが生す るようなことがない程度の厚さに選ばれることが

(7)

ている。第6回は、本発明による電極(1)と、従来 の酸化シリコン膜を有する電極の直流抵抗の温度 特性を測定した結果を示す。第6図中曲線06は第 4 図に説明した本発明による電極(1)における外囲 温度に対する直流抵抗値の測定値曲線で、曲線(17) は、第7図に示すように、シリコン基板は上に 2200 Aの厚さの SiO2 膜(19を熱酸化法によつて被 着して成る従来の電極201において、 SiO2 膜(19)上 に、Au磨切を被着して測定した同様の測定値曲 線である。これら曲線(10及び(17)を比較することに よつて明らかなよりに、本発明による電極(1)は、 通常の使用温度範囲で殆んどその抵抗値が変化し ないものであり、従来の電極例による場合に比し、 温度依存性は格段的に改善される。即ち、従来の 電極図では、20℃にかける抵抗が1.5 MΩである ものが 80 ℃ では 400 KΩに被少するが、本発明に よる電極(I)では、 20℃における抵抗が 600 KΩで あるものが、 80℃で 510 KΩに低下するに過ぎな

更に、 静電容量とtal 3 の態度依存性についても

次に、本発明による電極(1)についての諸特性に ついて述べるが、この諸特性の測定は、第4図に 示すように電板(1)の盤化シリコン膜(3)に、50mm² の面積の金 Au 層(13)を蒸着し、この金 Au 層(13)とシ リコン基板(2)に失々導電性接着剤によつてリード 般を取着して端子 t g 及び t g を導出する。この場 合、 Si₃N₄ 膜(3)の厚さは、1000Åに選んだ。先 ず、この電極(1)において、直流電流電圧特性を測 足した。その結果を第5図に示す。第5図中曲線 (10はAu 励(13例を正確何とした場合、曲線傾はAu 層(13) 倒を負極側とした場合である。これら曲線(14) 及び切によつて明らかなように、この場合、正負 非対称の特性を示し、Au層は個を負種側とする ときは切圧Vに対し電流Ⅰは、ほぼ直線的に増加 しているが、Au層は個を正極側とするときは、 - 1 V以下で、 log I 対 log V が直線的に減少し

(8)

20℃~80℃において測定した。第8図及び第9 図は、夫々20℃~80℃における温度変化に対す る静電容量及びは200各値の測定値曲線で、曲線 (21)及び四は、夫々第4回に示した本発明による電 極(1)の測定値曲線、23及び24は、夫々第7図に示 した従来の電極(1)の各側定値曲線である。これら 曲線より明らかなように、本発明による電棒(1)は、 静電容量及び^{tall} 8 に関しても、通常の使用温度範 囲で、その温度依存性が確めて小さいことがわか る。特に、静電容量についてみるに、従来の電極 Øでは、20℃で7.5nFを示していたものが、 80℃で8.5 n F となり、その変化量は20℃にか ける容量の13名にも及ぶものであるに比し、本 発明の電極(1)では、20℃で58mFであつたもの が80℃で59πドに変化するのみで、その変化量 は20℃における容量のわずか 1.7 多程度に過ぎ ない。

また、第10図及び第11図は、夫々周波数に対するインピーダンス及び容量の変化を測定した結果を示し、曲線図及び頃は、夫々第4図に示した

特開昭55-2416(4)

本発明による電極(1)の各測定結果を示し、曲額(27) 及び08は、第7回に示した従来の電極20の各測定 結果を示す。との場合、交流電流は 40 MA に選定 した。インピーダンスに関しては、電極(1)におい ても電極切においても、周波数1の増加と共に1 ンピーダンス z は減少しているが log f 対 log z は、いずれもほぼ直線的被少を示している。そし て、周波数一静配容量特性に関しては、曲線図と 08とを比較することによつて明らかなように、本 発明による覚徳(1)においては、従来の覚極のに比 し、広い局波数範囲において平坦な特性を示して いる。即ち、従来の電極似では、 0.1 Hz~100Hz の範囲で、ほぼ一定の容量となるものであるに比 し、本発明の電極(i)では 0.1 Hz ~ 500 Hz の範囲 で、ほぼ一定の容量を示す。即ち、本発明による 電極(1)によるときは、従来の電極のに比し、より 高い周波数の信号の検出が可能となることがわか る。

次に生理食塩溶液中での周波数勢電容量特性を 測定した。この場合、電極(!)は、第12回に示す

άĐ

を用意し、同様の測定を行つた。第 14 図中曲線のは、この SiO2 - Si 構造の周波数 - 静電容量特性である。これらの測定結果から明らかなように、従来の SiO2 - Si 構造の電極によるときは、 0.1 Hz ~ 30 Hz という狭い周波数範囲でのみほぼ一定の容量を示すものであるに比し、本発明の電極(1)によるときは、 0.1 Hz ~ 1 KHz の範囲において一定の容量値を示す。即ち、本発明の電種(1)によるときは、高い周波数成分の信号の検出がし易くなることがわかる。また、本発明による電極(1)によるとさがわかる。また、本発明による電極(1)には、単位面積当りの静電容量が大きくなるので、低い周波数成分の信号に関してもその検出が容易となる。

次化、同様の生理食塩水中での雑音についてみる。この場合、測定に用いた増幅器は、入力インビーダンスが $50\,\mathrm{M}\Omega$ 以上で、周放数帯域は、 $0.01\,\mathrm{Hz}\sim1000\,\mathrm{Hz}$ である。尚、ベンレコーダの周波数帯域は $D\,\mathrm{C}\sim20\,\mathrm{Hz}$ である。第 $15\,\mathrm{図}$ は、電極のそれである。第 $15\,\mathrm{図}$ ないて、

ように、透孔四を有する絶縁基板の上に、電板(1) の周辺を絶縁性扱着剤印によつて被覆するように 接着し、この接着剤師によつてシリコン基体(2)の 周辺における漏れ電流を防止する。そして、基体 (2)の裏面には、基板300の透孔29を通じてリード線 (32を導覧性接触剤(3)によつてとりつけ、このとり つけ部を同様の絶象性優着剤GDによつて覆う。尚、 との電極(1)のシリコン基件(2)上のSl₃N₄膜(3)の厚 さは、1000 Aで、その有効面積、即ち周辺の接 着剤(3)で覆われていない露出面積は約70 mm²と なつている。そして、この構造の電極(1)を、参照 電極としてのAg-AgC!構造を有する電極640と共 に、第13回に示すように、0.8分の食塩水溶液 中に漫漫する。この場合、 Ag - AgC1 電磁 64)は、 靴を(1)の有効面板の約300倍の面積に選ばれてい る。第14回中曲線的は、このようにして生理食 塩溶液中で測定した電極(1)の周波数 - 静電容量等 性である。一万、第12回に示したと同様の構造 とするも、誘電体膜として、那?図に説明したよ りに SiO2 膜を用いた従来の SIO2 - Si 構造の電極

12

横軸の1目盛は10秒間を、たて軸の1目盛は 1 4V を示す。これより明らかなように、Ag-AgCI 電極では、増幅器の入力短絡時における雑音とほ は等しい約 2μVpp の雑音が生じているに過ぎない が本発明による電極(1)では、約3 AVpp の雑音が生 じていて、低い周波数のドリフト的雑音が生じて いる。しかしながらこの雑音は、従来の8102-81 電極に比しては可成り改善されたものとなつてい る。 今、 0.9 % NaCl 溶液に、失々第 12 図に 説明 した本発明による電極(1)と、 SiO2 - Si 電極と、 Ag-AgCI 覧極とを養漬し、このAg-AgCI を参照 電極として、夫々の電極との間のドリフトを測定 した。第17回は打点式ペンレコーダによつて指 かせたドリフト測定結果で、同図中(a)はAg-AgC1 電 体、(b) は S1O2 - Si 電 框、(c) は SisN4-81 電極のそれである。この場合、使用した増幅 器の周波数帯域は、 0.01 Hz ~ 1000 Hz であり、 打点ペンレコーダの周波数帯域は、直流DC~ 2 Hz である。第 17 図において横軸の 1 目盛は 2 分を示し、たて軸の1目盛は50 AV を示す。これ

より明らかなように、 Ag-AgC1 電極では、約 $50\,\mu Vpp$ のドリフトが生じているに比し、 従来の SiO_2-Si 電極では、 その2 倍の約 $100\,\mu Vpp$ のドリフトが生じている。また、 この SiO_2-Si 電極では、Ag-AgC1 電極に比較して高い周波数成分のドリフトが生じている。これに比し、第17 図中 (c) に示されるように、 本発明による Si_3N_4-Si 電極においては、約 $60\,\mu Vpp$ のドリフトが生じているものの、Ag-AgC1 電極よりや中大きいという程度であり、 SiO_2-Si 電極の場合に比べては、格段的に波少している。

上述したように本発明による電像(I)は、温度依存性が小さく安定した特性を示し、高い周波数信号の検出も可能となり、ドリフト維音の改善をはかることができる。

次化、本発明化よる電極化よって脳波測定を行 り場合についてみる。

この場合、第18 図に示すように、人体の前頭 部に、金属電電切と、本発明による Si₃N₄ - Si 構成を有する電極(1)と、従来の SiO₂ - Si 構成を有

Œ5

ムをとると第20図に示す図が得られた。第20図 中(a)は金属電極切によるもの。 (b) は、本発明 による電極(1)によるもの、 (c) は SiO2 - Si 電極 図によるものである。この場合、(a)と(b)では、 即ち金属電極例と本発明による電極では、a波: (10Hz 付近) の存在が確認できるが。 (c) の SIO2-SI 電極側では、このα被は、わずかに確 認できる程度で、ハムによる波形の歪みが、この パターンに生じている。そしてこの 8iO2 - 8i 🛢 種間によるものは、 0 ~ 10 Hz での放分が多くな つている。これは、電極自体のドリフト雑音によ るものと思われ、第19図(c)の脳波の波形で基 線が太くなつて袋われたことと一致する。そして、 金属電極による場合、 50 Hz 付近の成分が殆んど 存在していないのに比べ、本発明による覚徳(j)と、 SiO₂~Si 電極においてこの付近の成分が存在し ていることや、第 19 図において、 (b) 及び (c) に示された本発明による電極(1)及び SiO2 - Si 包 極陽によつて測定された波形が (a) の金属電極 (37) の波形に比し、その基線が太くなつているのは、

特開昭55-2416(5)

する電極跳とを失々とりつけ、耳をアースする。 ここで、 Si₃N₄ - Si 電極(1)と、 SiO₂ - Si 電極(8) とは夫々爆獲自体のインピーダンスが高いので、 入力インピーダンスが 50 MΩ O インピーダンス 変換器を各能種(1)及び3個と検出装盤との間に介存 させる。金属電極師の顕那へのとりつけは、ペー ストによつて行うが、電極(1)及び翎のとりつけは 圧者テープによつて行つた。目を閉じた状態で測 定した脳波は、第19図化示すようになつた。第 19図において(a)は、金属電産のによつて測定 された脳波、(b) は本発明による電極(1)によつて 測定された脳波、 (c) は SiO₂ - Si による電極側 によつて測定された脳波である。全属電極例によ るものではα波が確認され、本発明の電極(i)によ る場合においてもα波が羅撃されている。しかし、 この電極(1)による場合、全異電極例による場合に 比し畜殺がヤヤ太くなつている。とれは、ハムド よる雑音と思われる。そして、SiO2-Si 電極器 による場合は、基級が更に太くなつていて、雑音 も多くなつている。この彼形の周波数スペクトラ

ñà

これら戦極(11及び)がに対し、インビーダンス変換器が直接的に接続されていないことによつて、各 電極(11及び)がとインビーダンス変換器との間のリード線によつて拾われる雑音と思われる。

そこで、電極(1)に対してできるだけ近接して設

けられることが望まれる回路、若しくは回路楽子は、電極(1)を配置する電極機体内に設ける。しかしながら生体電極は、遠常、これが損耗し易いので、比較的頻繁に使い捨てが行われる。したがつて、上述した要求から電極機体に、上述したよう

な回路又は回路果子を配設するも、この回路又は 回路累子は繰返し使用することができるように、 これに対し電極(1)を増脱交換できるようにする。

このようにした電極株体の一例を第 21 図を参照して説明するに、図中側はこの電極 株体を全体として示す。この電極株体側は電極(I)を保持する第 1 の部材(I)と、この第 1 の部材(I)と 類脱自在に連結され、上述したように、電極(I)に近接を成されるべき例には、半導体集後回路から成るインピーダンス変換器、増縮器、更に A M、F M、P M 各変調器、及び復調器等の回路又は回路索子(I) 各保持する第 2 の部材より構成される。

第1及び第2の各部材制及び約は、夫々絶縁体、 例えば樹脂モールド体によつて構成し得る。第1

49

更に、凹部50の内面、例えば凹部50の内周面又は底面の少くとも何れか一方には、部材42の成型と同時にこれと一体に、信号通路に汗等の液が流入することのないように環状の1本又は複数本の埋気を設ける。

このような解成による電極解体例は、脳波等の 測定に当つて生体に電極(1)の Si₃N₄ 膜(3)が密盤す 特開昭55-2416(6)

の部材似は、例えば円板ないしは円柱状に形成さ れ、その一方の面(41a)に臨んで覚極(1)を配置す る凹部(40)が設けられる。この凹部(41)の底面には、 金属液体的が配置される。この事体的には、これ と一体に柱体個が設けられ、部材側のモールド放 型時にこの柱体(46)が部材(41)を貫通して面(41a)と は反対側の面 (41a) に第呈するように埋込む。そ して、四部(4)内の導体(4)上に電極(1)を、シリコン 基体(2)と導体(5)とが電気的に連結されるように敵 せ、絶縁性の接着剤似化よつて、電極(1)を固着す る。この時電極(1)のSi3N4の誘電体膜(3)の角級部 を除く大部分が面 (41a)とほぼ同一平面内におい て外部に解呈するようにする。また、部材(41)の面 (41b) に片寄る似の周面は、面 (41a) 側の周面よ り小径となし、この小径部の外周に螺子帯側を形 成する。

第2の部材(個は、例えば第1の部材(側の大便部における外径とほぼ同径の円板状ないしは円柱状に形成され、第1の部材(側の螺子將(側と螺合する母螺(側を有する凹部)側が設けられ、この凹部)切内

20

るように圧滑テープによつてとりつける。

上述の散後機体傾によれば、これ自体体にでかって、これ自体になって、これ自体になって、は回路又は回路又は回路又は回路では、これを(1)との間に介存されるようで、上級を激素を使いている。というを強力を放果を使いている。というをを対している。という変化を対している。という変化を対して、これを検える。という変化を対して、これを検える。という変化を対して、これを検える。という変化を対して、これを検える。という変化を対して、高価などののは、これを検えるという変化を対して、高価などの対しに、高価などの対しに、高価などいう変化を対して、高価などいう変化を対して、高価などの対しに、高価などいう変換をしても、できるという変換をしてもる。

尚、上述した例では、電極標体例に本発明による電極(1)、即ち誘電体を用いた電極のみを配置したものであるが、成る場合は、第22図に示すように、第1の部材(4)の電極(1)が配置された面(41a)

特開昭55-2416(7)

このように金属電磁仰をも配置した構造とする時は、これによつて直流分の検出も可能となつて 測定目的、 取様に応じて本発明の誘電体による電 値(1)と金属電極との双方の特徴、利点を生かした 測定ができるので、その測定目的、態様に応じて

23

能極と共化PH溶液に浸漬し、そのPHの値が夫 夫 4.0、5.4、8.5、9.2、10.5のものについ て夫▲直流電流電圧特性を測定すると第23図中 曲盤仰~44に示すようになる。これら曲線より明 らかなように各密被で、電圧が増加するにつれ、 電流も増加する。このようにPHの変化によつて その直流電流電圧特性が変化するので、これを利 用することによつて電極(1)を用いてPH測定を行 うことができる。尚、このように、電極(1)は、 PHによつてその特性が変化するが、これは直流 に対しての現象であるので脳波等の測定において 交流信号の検出に関してこのPHの依存性による 問題はない。尚、Ag-AgC1 電磁側を正極とし、 Si3N4-Si 電極(1)側を負極とするときは、PH変 化による電流変化は認められず、また、不安定な 特性を示した。

図面の簡単な説明

第1図は本発明による生体用電極の一例の構成 図、第2図はそのSi₃N₄膜のCVD装置の構成図、 第3図はその処理時間と譲厚の関係を示す図、第 生体に対し、観像(I)と他の金属電極を貼り変える 手間や、測定条件の変化を来たすような不都合を 同時できる利益がある。

又、第 2 1 図及び第 2 2 図に示した例では、蝶子 神 個と母螺 似とを夫々部材 (1) 及び(4) を構成するモールド体に形成した場合であるが、或る場合は、これらモールド体に夫々蝶子神 個及び母螺 (4) が施 こされた金 顧 筒体を 超 撃 し、 むれ砂 金 異 筒体を 電 (1) 或いは 似と 回路 又は 回路 (4) 或いは リード 線 切に 接続することができる。即ちこれら金 異 筒体を 前述 の 浮体 (4) 又は (1) と、 5) 又は (7) とに 置き換えることができる。

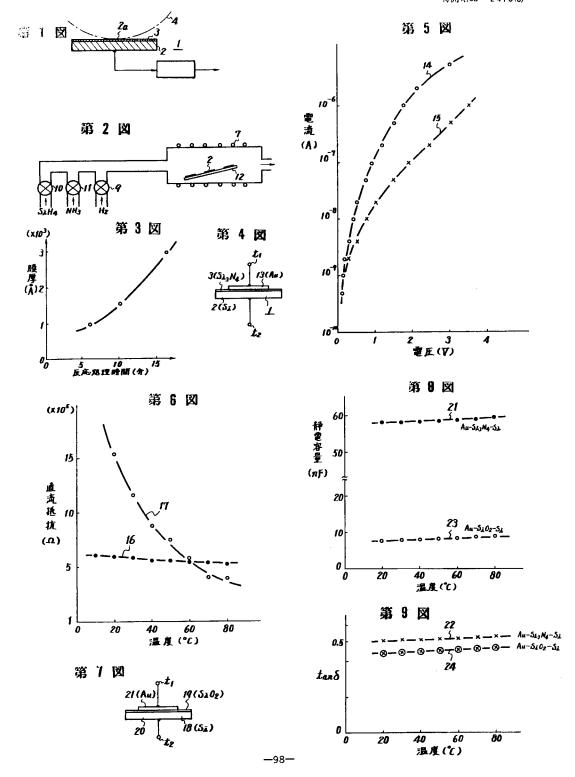
尚、上述の本発明による SiaN4 - Si 樹成による 能極(1) は、上述した脳波測定のみならず、心電図、 筋電図等の測定のための電極として用いることが できる。更にこの本発明による SiaN4 - Si 構成に よる能極は、 P H 測定に用いることもできる。 即 ち、本発明による SiaN4 - Si 構成の電極(1)を解12 図に示したと同様の構成として、これを、電極(1) の有効面積の約300倍の面積の Ag - AgC1 構成の

24

4 図は本発明による電板の特性測定のための構成 図。 第5 図 け その 電流 電圧 特性 曲線 図。 第6 図 は 高流抵抗 - 温度特性曲線図、第7回は比較例とな る従来の電極の構成図、第8図は容量 - 温度特性 図、第9図は448~温度特性曲線図、第10図は インピーダンス - 周波教特性曲線図、第11図は 容量 - 周波数特性曲線図、第12図は、本発明電 極の他の特性の測定のための構成図、第13図は その測定額機関、第14 図は容量 - 風波数特件曲 線図、第15 図及び第16 図は雑音測定波形図、 第17回は打点式ペンレコーダによるドリフト測 定結果を示す図、第18図は脳波測定の説明図、 第19 図は脳波の測定波形図、第20 図は脳波検出 の 局波数スペクトラム、第21 図及び第22 図は夫 夫本発明による電艦を用いた電極機体の例を示す 拡大断面図、第23図はPH溶液中の直流電流特

(1) は本発明による生体用電極、(2) はシリコン基体、(3) は Sl₂N₄ 誘電体膜、(40) は電極操体、(41) 及び(42) はその第1及び第2の部材である。

特閒昭55-2416(8)



特朗昭55-2416(9)

